

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 27 年 1 月 22 日 (2015.1.22)

【公表番号】特表 2014-514229 (P2014-514229A)

【公表日】平成 26 年 6 月 19 日 (2014.6.19)

【年通号数】公開・登録公報 2014-032

【出願番号】特願 2013-554843 (P2013-554843)

【国際特許分類】

C 0 1 B 33/18 (2006.01)

C 0 3 B 20/00 (2006.01)

C 0 3 B 8/02 (2006.01)

C 0 3 C 3/06 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 33/18 Z

C 0 3 B 20/00 D

C 0 3 B 20/00 F

C 0 3 B 8/02 B

C 0 3 B 8/02 G

C 0 3 B 8/02 L

C 0 3 C 3/06

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 26 年 11 月 27 日 (2014.11.27)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 4 8

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 4 8】

2.) 工程段階 g . ~ j . に従ったシリカ顆粒の製造

例 1

上記方法により製造された湿ったシリカ（固形分 23.6%）500g に、5 リットルのキャニスター内で V E 水 500g 及び 25% のアンモニア溶液 50g を混ぜた。勢いよく振り動かした後、ネジで蓋を閉めた状態のこの混合物を一晩かけて乾燥キャビネット内でエージングした；温度は、アルカリエージングプロセスの間、80℃であった。翌日に、生成物を 3000ml のピーカー（石英ガラス）に移し、かつ傾瀉洗浄した。計 5 回、そのつど V E 水 500ml で洗浄した；引き続き、ピーカー（石英ガラス）内の生成物を、160℃に調温された乾燥キャビネット内で一晩かけて乾燥した。乾燥した生成物を微粉碎し、かつ 250 ~ 350 μm の画分に篩分した。この画分の 20g を、1000ml のピーカー（石英ガラス）内で 1050℃へとマッフル炉内で 4 時間以内に加熱し、かつ、この温度で 1 時間保った；冷却はゆっくりと、炉内に放置することによって行った。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 5 2

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 5 2】

画分の 600g を、3000ml の石英ガラスピーカー内で 8 時間以内にマッフル炉内で 600℃へと加熱し、かつ、この温度で 4 時間保ち、その後、一晩かけて冷却させた。

次の日に、同じサンプルを、8 時間以内に 1 2 0 0 に加熱し、かつ、さらに 4 時間この温度で保った；冷却を、再び一晩かけて行った。焼結した生成物の微粉碎後に、再び 5 0 0 μ m の篩に通して濾過した。